

High Purity Anwendungen in der Bauteilereinigung

Die sehr hohen Anforderungen an die Bauteilsauberkeit vor allem in der EUV-Lithografie, Halbleiter-Zulieferindustrie, optischen und optoelektronischen Industrie, Vakuum-, Laser- und Analysetechnik und Luft- und Raumfahrt, Medizin- und Pharmatechnik brauchen Reinigungsmedien neuester Generation. Zum Beispiel kann ASML Grade 1 und 2 mit folgenden Produkten erreicht werden

Produkt	Verwendung/Eigenschaften
DANSOCLEAN® PC 3013	Alkalischer Vor- Reiniger frei von schwefel-, phosphor- und siliziumfrei, schaumfrei ab 40 °C
Leracid® PC 1035	Saurer Vor- Reiniger frei von schwefel-, phosphor- und siliziumfrei, schaumfrei ab 50 °C
Leratsen® PC D/US	Reinigungsverstärker speziell für saure und alkalische Vor-Reiniger
DANSOCLEAN® N 7073	Neutralreiniger für die Feinstreinigung, speziell für zyklische Nukleation, Pulse Pressure Cleaning und Druck-Wechselwaschen , phosphor-, schwefel- und siliziumfrei, schaumfrei ab 42 °C
DANSOCLEAN® N 6077	Neutralreiniger für die Feinstreinigung, speziell für zyklische Nukleation, Pulse Pressure Cleaning und Druck-Wechselwaschen, schaumfrei ab 52 °C
Leratsen® 950	Reinigungsverstärker speziell für Druck-Wechselwaschen, schaumfrei ab 52 °C
DANSOCLEAN® N 7083 US	Neutralreiniger für die Feinstreinigung, phosphor-, schwefel- und siliziumfrei, für US-Anwendungen
DANSOCLEAN® S 7040	Schwach-saurer Reiniger für die Feinstreinigung, schwefel- und siliziumfrei, schaumfrei ab 52 °C
DANSOCLEAN® S 7042 US	Schwach-saurer Reiniger für die Feinstreinigung, schwefel- und siliziumfrei, schaumfrei ab 52 °C, für US-Anwendungen

Ihre Vorteile

- Für alle High Purity-Anwendungen, Vor-Reinigung und Feinst-Reinigung
- Für empfindlichste Oberflächen wie Aluminium, Edelstahl, Titan, Nickel, Kupfer
- Hohe Materialverträglichkeit
- Frei von HiO-Elementen wie Phosphor-, Silizium- und Schwefelverbindungen